

THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

nit

36th Floor

Examiner

1600 Market Street

Serial No. Filed

09/628,405 August 1, 2000 Philadelphia, PA 19103

Inventors

Ichiro Tanokuchi Sachihiro Iida Docket: 1299-00

Title

GAS WIPING APPARATUS

AND METHOD

Dated: September 18, 2000

CLAIM FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. §119

Assistant Commissioner for Patents Washington, DC 20231

Sir:

We submit herewith the certified copy of Japanese Patent Application No. 11-224081 filed August 6, 1999, the priority of which is hereby claimed.

Respectfully submitted,

Austin R. Miller Reg. No. 16,602

Attorney for Applicants

ARM:sr

(215) 563-1810

TECHNOLOGY CENTER 1700



PATENT OFFICE

JAPANESE GOVERNMENT

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

Date of Application:

August 6, 1999

Application Number:

Hei 11-224081

Applicant(s):

Kawasaki Steel Corporation

OCT -5 2000 TECHNOLOGY CENTER 1700

August 4, 2000

Commissioner, Patent Office

Kozo OIKAWA

Certification No. 2000-3060671



日

本 国 特 許 庁 PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

1999年 8月 6日

出 顧 番 号 Application Number:

平成11年特許願第224081号

川崎製鉄株式会社

RECEIVED

OCT -5 2000

TECHNOLOGY CENTER 1700

2000年 8月 4日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office



川耕



【書類名】

特許願

【整理番号】

99J00656

【提出日】

平成11年 8月 6日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

C23C 2/20

【発明者】

【住所又は居所】 岡山県倉敷市水島川崎通1丁目(番地なし) 川崎製鉄

株式会社水島製鉄所内

【氏名】

田野口 一郎

【発明者】

【住所又は居所】

東京都千代田区内幸町2丁目2番3号 川崎製鉄株式会

社内

【氏名】

飯田 祐弘

【特許出願人】

【識別番号】 000001258

【氏名又は名称】 川崎製鉄株式会社

【代表者】 江本 寛治

【代理人】

【識別番号】

100066980

【弁理士】

【氏名又は名称】 森 哲也

【選任した代理人】

【識別番号】 100075579

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 嘉昭

【選任した代理人】

【識別番号】 100103850

【弁理士】

【氏名又は名称】 崔 秀▲てつ▼

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001638

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9901510

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ガスワイピング装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 液体浴中から引き上げられて連続的に上昇進行する帯状材の幅方向に沿って延在され、該帯状材の表面に向けてガスを噴出することにより、該表面に付着した液体の付着量を調節するガスワイピングノズルと、前記帯状材の幅方向の両側近傍の該帯状材の幅方向の延長面上で、前記ワイピングノズルから噴出されたガスが前記帯状材表面に衝突するガス衝突点を含む高さに配置された一対の遮蔽板と、該遮蔽板の内側と前記帯状材の幅方向の側縁との間に、ガス噴出口を前記ガス衝突点よりも該帯状材の進行方向の下流側に位置させて配置され、該帯状材の進行方向の上流側に向けて前記帯状材の幅方向の延長面内にガスを噴出するエッジワイピングノズルとを備えたガスワイピング装置において、

前記帯状材の幅方向の側縁と前記遮蔽板の内側との間隙C(mm)を4~7mmとし、

更に、前記エッジワイピングノズルのガス噴出口と前記ガス衝突点との距離をL (mm) とした場合に、距離Lと間隙Cとの関係が $-2.0C+20 \le L \le -2.5C+45$ を満足することを特徴とするガスワイピング装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、例えば鋼帯に溶融金属鍍金を行うに際し、溶融鍍金浴から引き上げられた後、余分な鍍金をガスワイピングで払拭する場合のガスワイピング装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

鋼帯に亜鉛鍍金を施す連続式溶融亜鉛鍍金ラインでは、図8に示すように、溶 融亜鉛鍍金浴から引き上げられた鋼帯 a の表裏両面に向けてワイピングノズル b からガスを噴出して該表裏両面に余分に付着している溶融亜鉛を払拭し、これに より、鍍金の付着量を制御するようにしているが、このような鍍金の付着量制御 では、ワイピングノズル b から噴出されたガスが鋼帯 a の幅方向の両側部において該幅方向外方に逃げるために、鋼帯 a の幅方向の側縁に鍍金金属が余分に付着するいわゆるエッジオーバーコートが発生し易いという問題があった。

[0003]

そこで、本出願人等は、このエッジオーバーコートの発生を防止する対策として、特開平1-208441号公報に記載されたガスワイピング装置を先に提案 した。

このガスワイピング装置は、図9に示すように、上述したワイピングノズルbの他に、鋼帯 a の幅方向の両側近傍の該幅方向の延長面上で、ワイピングノズルbから噴出されたガスが鋼帯 a の表面に衝突するガス衝突点 A を含む高さに配置された一対の遮蔽板 c と、該遮蔽板 c の内側と鋼帯 a の幅方向の側縁との間に、ガス噴出口 d をガス衝突点 A よりも該鋼帯 a の進行方向の下流側に位置させて配置され、該鋼帯 a の進行方向の上流側に向けて鋼帯 a の幅方向の延長面内にガスを噴出するエッジワイピングノズル e とを備えたものであり、遮蔽板 c によって、鋼帯 a の表裏面側に配置されたワイピングノズル b から噴出されたガス流が鋼帯 a の幅方向の両側部外方で相互干渉し合うのを防止して該ガス流を整流化し、これにより、エッジオーバーコートの発生を防止すると共に、エッジワイピングノズル d から噴出されたガスによって、ワイピング時に発生するスプラッシュと呼ばれる微小溶融金属が鋼帯 a の幅方向の側部に近接配置された遮蔽板 c に付着堆積して成長するのを防止したり、遮蔽板 c と鋼帯 a の幅方向の側縁との間に溶融金属が頻繁に橋状に成長するのを防止するようにしている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、かかる従来のガスワイピング装置においては、遮蔽板及びエッジワイピングノズルの設置位置によっては、エッジオーバーコート及びスプラッシュの発生を十分に防止することができないという不都合が生じた。

ここで、本発明者等は、このような不都合が生じる原因を解明すべく、遮蔽板 及びエッジワイピングノズルの設置位置を変更してエッジオーバーコート及びス プラッシュの発生の有無を調査したところ、次に示す知見を得た。

[0005]

即ち、遮蔽板については、鋼帯の幅方向の側縁と遮蔽板の内側との間隙C(mm)が4mm未満では、遮蔽板にスプラッシュが付着・堆積し易くなって、鋼帯の幅方向の側部と遮蔽板との間に溶融金属が頻繁に橋状に成長しやすくなり、7mmを越えると、噴出圧の強力なエッジワイピングノズルを設置したとしても、鋼帯の幅方向の側部におけるワイピングガスの吹き付け圧力比率(鋼帯の幅方向の中央部を"1"とした場合の比率)が小さくなって該側部の溶融金属が十分に払拭されず、結果として大きなエッジオーバーコートの発生を防ぐことができなくなり、また、鋼板の幅方向の側部と遮蔽板とが離れているものの、場合によっては、スプラッシュが遮蔽板に付着・堆積してしまうという知見を得た。

[0006]

一方、エッジワイピングノズルについては、上記間隙Cの値によって異なるが、エッジワイピングノズルのガス噴出口とワイピングノズルのガス衝突点との距離L(mm)がある値より小さい場合には、エッジワイピングノズルからの噴出ガス量またはガス圧力を如何に調整しても、ワイピング時に発生するスプラッシュがエッジワイピングノズルに再付着して堆積していき、ある厚みになると、鋼帯の幅方向の側部に再付着するという不具合が発生し、距離Lがある値より大きい場合には、エッジワイピングノズルからの噴出ガス量またはガス圧力を如何に調整しても、このエッジワイピングの効果は弱くなり、ワイピング時に発生するスプラッシュが遮蔽板に付着堆積して成長したり、遮蔽板と鋼帯の幅方向の側縁との間に溶融金属が頻繁に橋状に成長するという知見を得た。

[0007]

本発明はかかる知見に基づいてなされたものであり、エッジオーバーコート及 びスプラッシュの発生を良好に防止することができるガスワイピング装置を提供 することを目的とする。

[8000]

【課題を解決するための手段】

本発明者等は上記知見に基づき更に鋭意研究を行ったところ、エッジオーバーコート及びスプラッシュの発生を良好に防止することができる上記間隙C (mm

)と距離し(mm)との関係を見い出し、本発明を完成するに至った。

即ち、本発明に係るガスワイピング装置は、液体浴中から引き上げられて連続的に上昇進行する帯状材の幅方向に沿って延在され、該帯状材の表面に向けてガスを噴出することにより、該表面に付着した液体の付着量を調節するガスワイピングノズルと、前記帯状材の幅方向の両側近傍の該帯状材の幅方向の延長面上で、前記ワイピングノズルから噴出されたガスが前記帯状材表面に衝突するガス衝突点を含む高さに配置された一対の遮蔽板と、該遮蔽板の内側と前記帯状材の幅方向の側縁との間に、ガス噴出口を前記ガス衝突点よりも該帯状材の進行方向の下流側に位置させて配置され、該帯状材の進行方向の上流側に向けて前記帯状材の幅方向の延長面内にガスを噴出するエッジワイピングノズルとを備えたガスワイピング装置において、

前記帯状材の幅方向の側縁と前記遮蔽板の内側との間隙C(mm)を4~7mmとし、

更に、前記エッジワイピングノズルのガス噴出口と前記ガス衝突点との距離をL (mm) とした場合に、距離Lと間隙Cとの関係が $-2.0C+20 \le L \le -2.5C+45$ を満足することを特徴とする。

[0009]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態の一例を図を参照して説明する。図1は本発明の実施の形態の一例であるガスワイピング装置を説明するための説明的平面図、図2は図1の矢印II方向から見た図でワイピングノズルを破断した図、図3は図1のIIIIIII線断面図、図4はエッジオーバーコート及びスプラッシュの発生を良好に防止することができる距離Lと間隙Cとの関係を示すグラフ図、図5はエッジオーバーコート率を説明するための説明図、図6は本発明例と比較例とにおけるスプラッシュによる製品歩留りの低下率を示すグラフ図、図7は本発明例と比較例とにおける溶融亜鉛の消費量を示すグラフ図である。

[0010]

図1~図3を参照して、溶融鍍金浴中の溶融金属(例えば溶融亜鉛等)から引き上げられて連続的に上昇進行する鋼帯9の表裏両面側には、鋼帯9の幅方向に

延在するワイピングノズル2, 2が設置されている。ワイピングノズル2, 2にはスリット状のガス噴出口21, 21が形成されており、該ガス噴出口21, 21から鋼帯Sの表裏両面へ向けて幅方向に均一な圧力(この実施の形態では1kg/cm²以下)でガスを噴出し、鋼帯9の表裏両面に付着した余剰の溶融金属を払拭しその目付量を調整する。

[0011]

ワイピングノズル2,2は、鋼帯9の幅方向の側部から外方に延長されており、これにより、異なる幅(通常500~1550mm)の鋼帯に対してもワイピングノズル2,2の交換をすることなくワイピングを可能にしている。

ワイピングノズル2,2の上方には、鋼帯Sの幅方向に延在する梁5,5が架設されており、この梁5,5上を台車3に軸支された車輪4が転動して台車3が鋼帯9の幅方向に移動するようになっている。台車3の移動は、台車3に内蔵された例えばモータのような駆動手段10により車輪4を正逆いずれかの方向に回転させることにより行われる。

[0012]

台車3の下部には、鋼帯9の幅方向の外側においてワイピングノズル2,2から噴出されたガス流が相互干渉するのを防止して該ガス流を整流化し、これにより、エッジオーバーコートの発生を防止する遮蔽板6が固定されている。

遮蔽板6は、ガスワイピングを行っている際、鋼帯9の幅方向の側縁(以下、エッジ部91という。)近傍の鋼帯9の幅方向の延長面上に位置しており、ワイピングノズル2,2から噴出されたガスが鋼帯9の表裏両面に衝突するガス衝突点Aを含む高さに設置されている。

[0013]

なお、遮蔽板6の下端の鋼帯9の進行方向上流側への延長長さが長いとスプラッシュが付着し易くなるため、好ましくない。従って、遮蔽板6の下端は、ガス衝突点Aより下側に5~20mmとするのが好ましい。この場合でも、ワイピングノズル2,2から噴出されたガスの相互干渉防止効果を十分に得ることができる。

[0014]

遮蔽板6の内側端部61と鋼帯9のエッジ部91との間には、エッジワイピングノズル7が、そのガス噴出口71をガス衝突点Aより鋼帯9の進行方向の下流側に位置させて設けられている。このエッジワイピングノズル7は鋼帯9のエッジ部91と略平行に配置されており、ガス噴出口71から鋼帯9の進行方向の上流側に向けて鋼帯9の幅方向の延長面内に所定圧(この実施の形態では2kg/cm²以下)のガスを噴出する。エッジワイピングノズル7へのガスの供給は、該ノズル7に接続された送気管8を通じて行われる。

[0015]

これにより、鋼帯9の幅方向の外側に飛散するスプラッシュがエッジワイピングノズル7から噴出されるガス流により大幅に軽減され、該スプラッシュが遮蔽板6やエッジワイピングノズル7等に付着するのを防止することができると共に、遮蔽板6と鋼帯9のエッジ部91との間に溶融金属が頻繁に橋状に成長するのを防止することができる。

[0016]

なお、エッジワイピングノズル7のガス噴出方向を若干鋼帯9側に向け、又は逆に遮蔽板5側に向けることも可能である。前者の場合にはエッジ部91付近のワイピング力が強くなり、後者の場合は弱くなるため、エッジワイピングノズル7からのガス噴出量(噴出圧)を適宜増減させて適正化を図れば良い。

また、この実施の形態では、エッジワイピングノズル7が遮蔽板6の内側端部61に固定されて遮蔽板6と鋼帯9の幅方向に同時に移動する構成となっているが、これに限らず、エッジワイピングノズル7と遮蔽板6とを分離してこれらを独立又は連動させて鋼帯9の幅方向に移動させるようにしてもよい。

[0017]

遮蔽板6及びエッジワイピングノズル7の鋼帯9の幅方向への移動は、溶融金 属鍍金を行う鋼帯9の幅を変える際の初期位置を設定する場合に行われる。

また、溶融金属鍍金を行っている間に鋼帯9が幅方向に蛇行することがあるが、この蛇行に追従して遮蔽板5及びエッジワイピングノズル7を移動させるようにすべく、この実施の形態では、エッジ部91と遮蔽板6の内側端部61との間隙C(mm)を一定範囲に保持するように駆動手段10を制御する制御手段(図

示せず。)を設けている。

[0018]

ここで、この実施の形態では、上述した遮蔽板6によるエッジオーバーコートの防止効果及びエッジワイピングノズル7によるスプラッシュの防止効果を確実に得るべく、エッジ部91と遮蔽板6の内側端部61との間隙C(mm)を4~7mmとすると共に、該間隙Cと、エッジワイピングノズル7のガス噴出口71とガス衝突点Aとの距離L(mm)との関係が次式(1)を満足するようにしている。なお、図4に(1)式を満足する間隙Cと距離Lとの関係をグラフ化したものを示す。

[0019]

 $-2. 0C + 20 \le L \le -2. 5C + 45$... (1)

次に、表1を参照して更に詳述する。

[0020]

【表1】

					<u>.</u>					
	No.	C (mm)	L (mm)	鋼帯通 板速度 (m/分)	ワイピ ングガ ス圧力 (kg/cm²)	鋼板亜 鉛鍍金 付着量 片面 (g/m²)	エッジ ワイピ ングガ ス圧力 (kg/cm²)	スッラック インタイプション インタイプ かいまま アイス	エッジ オ-バ- コ-ト 上率 P(%)	判定
比較例	1	3	10	80	0. 45	45	1. 0	有り	3	否
比較例	2	3	20	90	0. 50	45	1. 0	有り	4	否
比較例	3	3	30	90	0. 25	60	1. 0	有り	3	否
比較例	4	4	10	85	0. 50	45	1. 0	有り	4	否
実施形態例	5	4	15	80	0. 45	46	1. 0	無し	5	良
実施形態例	6	4	20	90	0. 50	47	1. 0	無し	4	良
実施形態例	7	4	20	90	0. 35	65	1. 0	無し	4	良
実施形態例	8	4	30	115	0. 60	44	1. 0	無し	3	良
実施形態例	9	4	30	95	0. 50	45	1. 0	無し	3	良
比較例	10	4	40	100	0. 40	50	1. 0	有り	7	否
比較例	11	4	40	100	0. 33	60	2. 0	有り	8	否
比較例	12	7	5	90	0. 45	45	1. 0	有り	3	否
比較例	13	7	5	90	0. 50	40	1. 0	有り	5	否
実施形態例	14	7	8	95	0. 85	35	1. 0	無し	5	良
実施形態例	15	7	8	95	0. 55	40	1. 0	無し	4	良
実施形態例	16	7	15	90	0. 35	60	1. 0	無し	4	良
実施形態例	17	7	15	90	0. 37	55	1. 0	無し	3	良
実施形態例	18	7	25	100	0. 40	60	1. 0	無し	4	良
実施形態例	19	7	25	100	0. 55	45	1. 0	無し	5	良
比較例	20	7	30	95	0. 50	42	1. 0	有り	9	否
比較例	21	7	30	95	0. 70	37	1. 0	有り	8	否
比較例	22	9	10	90	0. 85	30	1. 0	無し	8	否
比較例	23	9	20	90	0. 60	40	1. 0	無し	9	否
比較例	24	9	30	90	0. 60	42	1. 0	無し	10	否
比較例	25	9	30	95	0. 60	42	2. 0	無し	9	否
比較例	26	9	30	95	0. 65	40	3. 0	有り	8	否

[0021]

表1中、No. 1~4、No. 10~13及びNo. 20~26は(1)式を 満足しない比較例とし、No. 5~9及びNo. 14~19は(1)式を満足す る実施形態例とした。なお、比較例及び実施形態例共に、鋼帯の幅を900mm、目付量を $45g/m^2$ 、遮蔽板6の寸法を上下幅20×長さ600mm、エッジワイピングノズル7の内径を3mmとした。

[0022]

比較例1~3は間隙Cを3mmとした場合であるが、いずれも鋼帯9に発生するエッジオーバーコートは抑えることができるものの、遮蔽板6に堆積するスプラッシュと、遮蔽板6と鋼帯9のエッジ部91との間に成長する橋状亜鉛が頻繁に発生し、操業を安定して継続することができなかった。

ここで、エッジオーバーコートは、図5に示すように、鋼帯9の幅方向の中央 部の付着量W1と、エッジ部91の付着量W2から次式で計算されるエッジオー バーコート率で判定し、実際には、実用上支障無い5%以下を合格とした。

[0023]

エッジオーバーコート率 $P = (W2 - W1) / W1 \times 100$ (%)

さらに、距離Lについて詳細に調査、実験をしたところ、次のようなことが判明した。

まず、間隙Cが4mmと比較的小さい場合、距離Lを変えて操業したところ、 距離Lが10mmと小さい比較例4の場合は、エッジオーバーコート率について は小さくて問題ないが、エッジワイピングノズル7のガス噴出口71とガス衝突 点Aとが近いために、スプラッシュがエッジワイピングノズル7の配管の内側、 つまり鋼帯9のエッジ部91側に頻繁に付着堆積し、操業上支障をきたした。

[0024]

距離Lが $15\sim30$ mmの実施形態例 $5\sim9$ の場合は、このスプラッシュの問題はほぼ解消した。

逆に、距離Lが40mmと大きい比較例10,11の場合は、エッジワイピングノズル7を設けたことによる効果、即ち、遮蔽板6に堆積するスプラッシュと、遮蔽板6と鋼帯9のエッジ部91との間に成長する橋状亜鉛を防ぐという効果を得ることができなくなり、操業上支障をきたすばかりか、エッジオーバーコート率も大きくなり、製品の品質上も問題があった。

[0025]

次に、間隙Cが7mmと比較的大きい場合では、距離Lが5mmと小さい比較例12,13の場合は、エッジオーバーコート率はほぼ問題ないが、比較例4と同様に、エッジワイピングノズル7のガス噴出口71とガス衝突点Aとが近いために、スプラッシュがエッジワイピングノズル7の配管の内側、つまり鋼帯9のエッジ部91側に頻繁に付着堆積し、操業上支障をきたした。

[0026]

距離Lが8~25mmの実施形態例14~19の場合は、このスプラッシュの問題はほぼ解消した。

逆に、距離Lが30mmと大きい比較例20,21の場合は、比較例10,1 1と同様に、エッジワイピングノズル7を設けたことによる効果、即ち、遮蔽板6に堆積するスプラッシュと、遮蔽板6と鋼帯9のエッジ部91との間に成長する橋状亜鉛を防ぐという効果を得ることができなくなり、操業上支障をきたすばかりか、エッジオーバーコート率も大きくなり、製品の品質上も問題があった。

[0027]

さらに、間隙Cが7mmを超える比較例22~26の場合は、強力なエッジワイピングノズル7を設置(比較例25,26)したとしても、鋼帯9のエッジ部91におけるワイピングガスの吹き付け圧力比率が中央部より小さくなってしまい、エッジ部91の溶融金属が十分に払拭されず、結果として大きなエッジオーバーコートの発生を防ぐことができなくなり、また、遮蔽板6とエッジ部91が離れているものの、場合によっては、スプラッシュが遮蔽板6に付着堆積することが判明した。

[0028]

結局、上記研究の結果により、エッジオーバーコートを品質上問題ないまでに防ぎ、かつスプラシュによる操業、品質上の問題ない操業上の間隙Cと距離Lとの関係を上記(1)式とした。

図6に(1)式を満足する場合(本発明例)と満足しない場合(比較例)とにおけるスプラッシュによる製品の歩留り低下率を示す。なお、その他の条件は同一とした。図6から明らかなように、本発明例では、製品の歩留りが比較例に比べて約0.4%改善されているのが判る。

[0029]

また、図7に(1)式を満足する場合(本発明例)と満足しない場合(比較例)とにおける溶融亜鉛の消費量を示す。なお、その他の条件は同一とした。図7か明らかなように、本発明例では、エッジオーバーコート率の削減により溶融亜鉛消費量が比較例に比べて約1%削減できたのが判る。

[0030]

【発明の効果】

上記の説明から明らかなように、本発明によれば、エッジオーバーコート及び スプラッシュの発生を良好に防止することができるという効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施の形態の一例であるガスワイピング装置を説明するための説明的平面図である。

【図2】

図1の矢印 I I 方向から見た図でワイピングノズルの破断した図である。

【図3】

図1のIIIーIII線断面図である。

【図4】

エッジオーバーコート及びスプラッシュの発生を良好に防止することができる 距離Lと間隙Cとの関係を示すグラフ図である。

【図5】

エッジオーバーコート率を説明するための説明図である。

【図6】

本発明例と比較例とにおけるスプラッシュによる製品歩留りの低下率を示すグラフ図である。

【図7】

本発明例と比較例とにおける溶融亜鉛の消費量を示すグラフ図である。

【図8】

従来のガスワイピング装置を説明するための説明的概略図である。

【図9】

従来のガスワイピング装置を説明するための説明的概略図である。

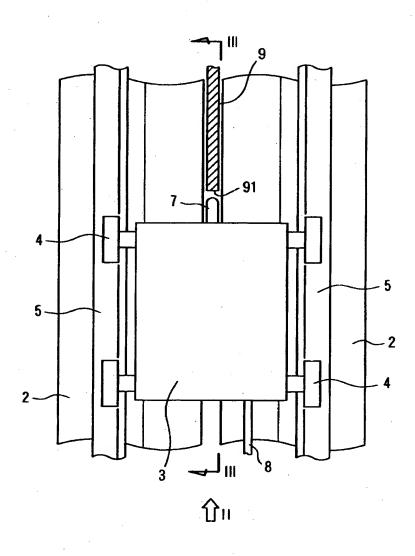
【符号の説明】

- 2…ガスワイピングノズル
- 6…遮蔽板
- 61…遮蔽板の内側端部
- 7…エッジワイピングノズル
- 71…ガス噴出口
- 9 …鋼帯
- 91…エッジ部
- A…ガス衝突点
- C…エッジ部と遮蔽板の内側端部との間隙C (mm)
- L…エッジワイピングノズルのガス噴出口とガス衝突点との距離

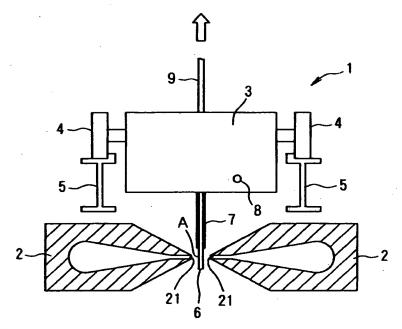
【書類名】

図面

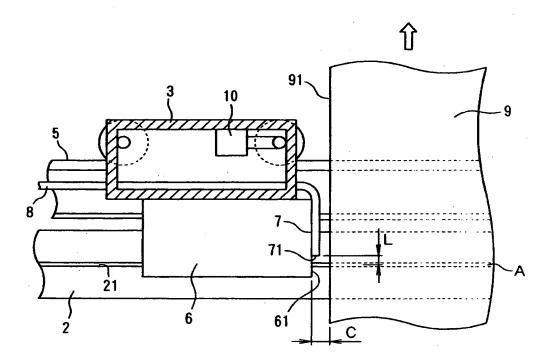
【図1】



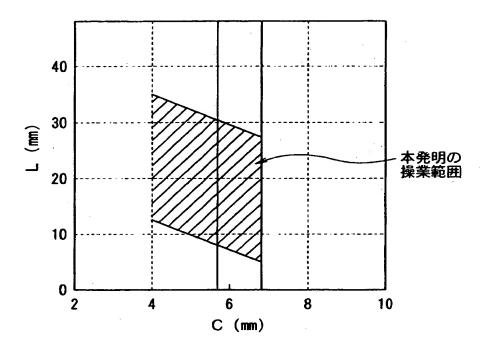
【図2】



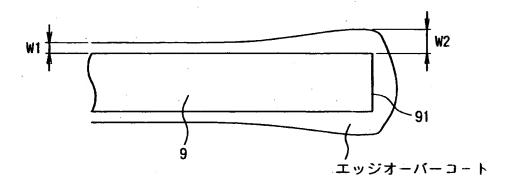
【図3】



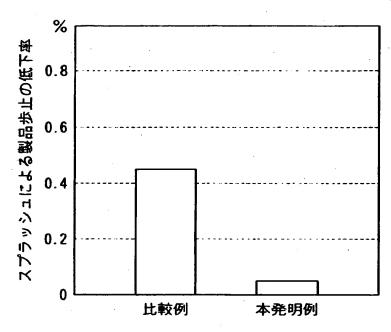
【図4】



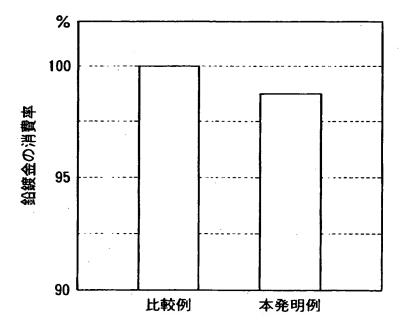
【図5】



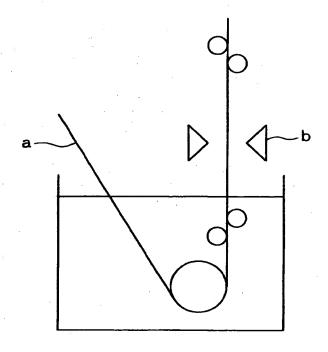
【図6】



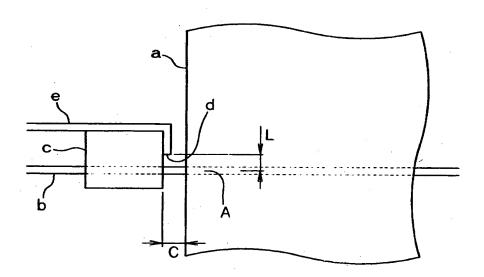
【図7】



[図8]



【図9】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 エッジオーバーコート及びスプラッシュの発生を良好に防止する。

【解決手段】 溶融金属中から引き上げられて上昇進行する網帯9の幅方向に延在されたガスワイピングノズル2,2と、網帯幅方向両側近傍の網帯幅方向延長面上で、ノズル2,2から噴出されたガスの網帯衝突点Aを含む高さに配置された遮蔽板6,6と、遮蔽板6の内側と網帯9のエッジ部91との間に、ガス噴出口71を衝突点Aよりも網帯進行方向の下流側に位置させて配置され、網帯進行方向の上流側に向けて網帯幅方向の延長面内にガスを噴出するエッジワイピングノズル7とを備えたガスワイピング装置において、エッジ部91と遮蔽板6の内側との間隙C(mm)を4~7mmとし、ノズル7のガス噴出口71とガス衝突点Lとの距離をL(mm)とした場合に、距離Lと間隙Cとの関係が-2.0C+20≦L≤-2.5C+45を満足することを特徴とする。

【選択図】 図3

出願人履歴情報

識別番号

[000001258]

1. 変更年月日

1990年 8月13日

[変更理由]

新規登録

住 所

兵庫県神戸市中央区北本町通1丁目1番28号

氏 名

川崎製鉄株式会社